Attorney Docket No. 15162/04070

3653

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

COPY OF PAPERS ORIGINALLY FILED

In re

FEB 2 0 2002

U.S. applicatid

For:

U.S. Serial No.:

Confirmation No.:

Filed:

Group Art Unit:

Examiner:

Assistant Director for Patents

Washington, D.C. 20231

Dear Sir:

Yasuhisa FUJII and Yasuhiro SANDO

PARTICLE SEPARATION MECHANISM

10/010,665

8688

December 6, 2001

3653

To Be Assigned

RECEIVED

FEB 2 7 2002

GROUP 36

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in an envelope addressed to: Assistant Director For Patents, Washington, D.C. 20231 on:

> January 24, 2002 Date of Deposit

.

James W. Williams
Name of Applicant, Assignee, or Registered Representative

Jamelle Willeam

January 24, 2002 Date of Signature

CERTIFIED COPIES OF PRIORITY DOCUMENTS

Submitted herewith are certified copies of Japanese Patent Application Nos. 2000-374852 filed December 8, 2000 and 2001-305231 filed on October 1, 2001.

Priority benefit under 35 U.S.C. \$ 119/365 for the Japanese patent applications are claimed for the above-identified United States patent application.

Respectfully submitted,

James W. Williams

Registration No. 20,047 Attorney for Applicants

JWW/rb SIDLEY AUSTIN BROWN & WOOD LLP 717 North Harwood Suite 3400 Dallas, Texas 75201-6507 (214) 981-3328 (direct) (214) 981-3300 (main) January 24, 2002

1



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年12月 8日

RECEIVED

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-374852

FEB 2 7 2002

出 顧 人
Applicant(s):

ミノルタ株式会社

GROUP 3600

2001年10月19日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2000-374852

【書類名】

特許願

【整理番号】

174069

【提出日】

平成12年12月 8日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01N 1/00

G01N 27/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビ

ル ミノルタ株式会社内

【氏名】

藤井 泰久

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビ

ル ミノルタ株式会社内

【氏名】

山東 康博

【特許出願人】

【識別番号】

000006079

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビ

ル

【氏名又は名称】

ミノルタ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100062144

【弁理士】

【氏名又は名称】

青山 葆

【選任した代理人】

【識別番号】

100079245

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 晃

【選任した代理人】

【識別番号】

100114502

【弁理士】

【氏名又は名称】 山本 俊則

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013262

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1 。

【物件名】

要約書 1

【物件名】

委任状 1

【援用の表示】

平成12年11月30日提出の包括委任状

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 粒子分離機構

【特許請求の範囲】

【請求項1】 粒子を含む溶液が流れることができる流路と、

上記粒子を含む上記溶液を上記流路に流すためのマイクロポンプと、

上記流路の途中において上記流路を横断する方向に電界を生じさせるように、 電圧を印加することができる電極と、

上記流路内において上記電界により上記粒子が寄せられる側に配置され、該粒子を捕らえることができる粒子捕捉部とを備えたことを特徴とする粒子分離機構

【請求項2】 上記電極は、上記流路を挟んで対向して配置され、

上記粒子捕捉部は、上記流路を形成する面の上記電極の一方側にその基端を有し、該基端から上記電極の他方側に向けて突出し、その先端は上記流路の略中央 に配置される突起部であることを特徴とする、請求項1記載の粒子分離機構。

【請求項3】 上記粒子捕捉部は、柱状の複数の上記突起部を含み、隣接する上記突起部間の隙間は、0.1 μ m以上50 μ m以下であることを特徴とする、請求項2記載の粒子分離機構。

【請求項4】 上記流路は、流れ方向上流側に一つの主流路を含み、流れ方向下流側に上記主流路から分岐する2以上の分岐流路を含み、

上記主流路と上記分岐流路との分岐点近傍において、互いに隣接する上記主流路及び上記各分岐流路の間にそれぞれ上記電極が配置されたことを特徴とする、 請求項1記載の粒子分離機構。

【請求項5】 上記電極は、シリコンの基板に高濃度の不純物をドープして 形成され、

上記流路は、上記基板の上記不純物がドープされた領域を部分的にエッチング 加工により除去することにより形成されたことを特徴とする、請求項4記載の粒 子分離機構。

【請求項6】 請求項1乃至5記載の粒子分離機構を用いて、溶液から粒子を分離する粒子分離装置であって、

上記粒子分離機構の上記マイクロポンプを駆動するマイクロポンプ駆動回路と

上記電極に電圧を印加する電圧印加回路と、

上記マイクロポンプ駆動回路および上記電圧印加回路の動作を制御する制御回路とを備えたことを特徴とする、粒子分離装置。

【請求項7】 粒子分離機構を用いて、溶液中に含まれる粒子を分離する粒子分離方法であって、

上記粒子分離機構に形成された流路に、上記粒子を含む上記溶液を流す第1ス テップと、

上記流路を横断する方向に電界を生じさせる第2ステップと、

上記流路を流れる上記溶液中の上記粒子を、上記電界の方向に寄せる第3ステップと、

上記電界の方向に寄せられた上記粒子を、上記流路内の上記粒子が寄せられる側に形成されたマイクロストラクチャーで捕捉する第4ステップとを備えたことを特徴とする、粒子分離方法。

【請求項8】 粒子分離機構を用いて、溶液中に含まれる粒子を分離する粒子分離方法であって、

上記粒子分離機構に形成された途中から少なくとも2つに分離する流路に、上 記粒子を含む上記溶液を流す第1ステップと、

上記流路の分離部近傍において、下流側の一方の流路側から下流側の他方の流 路側に電界を生じさせる第2ステップと、

上記電界により、上記流路を流れる上記溶液中の上記粒子を、下流側のいずれか一つの流路側に寄せ、その流路を流れるようにする第3ステップとを備えたことを特徴とする、粒子分離方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、粒子分離機構に関し、詳しくは、溶液中に含まれる粒子を分離するために用いることができる粒子分離機構に関する。

[0002]

【従来の技術】

最近、マイクロマシン技術を応用して、化学分析や合成などの機器・手法を微細化して行うμ-TAS(μ-Total Analysis System)が注目されている。

[0003]

例えば、溶液に含まれる粒子を分離するμ-TASの分離機構として、流路途中に微細加工技術によりマイクロストラクチュアーや高分子ゲルを充填してフィルターを形成し、粒子サイズによる分離を行うという考え方があった。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

この場合、フィルターは、流路底面から上面まで流路断面全体に形成されている。そのため、ポンプによる溶液推進力を用いて粒子をフィルターで分離しようとした場合、一般的に分離されるサイズ(サブμmから30μm程度)では、フィルターの穴が小さくなり過ぎて流路抵抗が大きくなり、溶液がフィルターを透過するようにすることが困難であった。

[0005]

また、発生圧力の極端に強いポンプによって、穴が比較的大きなフィルターを 溶液が透過する場合、初めのうちは粒子の分離は可能であっても、やがて分離さ れた粒子がフィルターの穴に詰まってしまい、流路抵抗が極端に大きくなり、溶 液を輸送できなくなる。

[0006]

したがって、本発明が解決しようとする技術的課題は、粒子を連続して効率的に分離することができる粒子分離機構を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段及び作用・効果】

本発明は、上記技術的課題を解決するために、以下の構成の粒子分離機構を提供する。

[0008]

粒子分離機構は、粒子を含む溶液が流れることができる流路と、上記粒子を含む上記溶液を上記流路に流すためのマイクロポンプと、上記流路の途中において上記流路を横断する方向に電界を生じさせるように、電圧を印加することができる電極と、上記流路内において上記電界により上記粒子が寄せられる側に配置され、該粒子を捕らえることができる粒子捕捉部とを備える。

[0009]

上記構成において、粒子を含む溶液は、マイクロポンプの吐出(又は吸引)により流路を流れる。流路を流れる溶液中の粒子は、電極に印加された電圧によって流路を横断する方向に生じた電界中を進行するときに、電界の方向(又はそれとは逆方向)に進行方向が曲げられ、流路の片側(例えば+側)に寄せられ、そこに配置された粒子捕捉部で捕捉される。これにより、粒子を含む溶液から、所望の粒子を分離することができる。

[0010]

上記構成によれば、流路の片側(例えば+側)に粒子捕捉部が配置されるものの、流路の他側(例えば-側)には何も配置されないので、流路の横断方向全体に粒子が詰まり、溶液の流れを阻害することはない。つまり、溶液は流路の他端側を常に妨げられることなく流れることができる。

[0 0 1 1]

したがって、連続して効率的に粒子を分離することができる。

[0012]

また、粒子が流路方向に進む推進力は、マイクロポンプにより与えられる。電 圧は、流路を横断する方向の極めて短い距離の間に電界を生じさせて粒子の進行 方向を切り換えるためだけに印加すればよいので、粒子を流路方向に電気泳動に より推進する場合に比べ、遥かに小さい電圧を印加するだけでよい。

[0013]

具体的には、以下のように種々の態様で構成することができる。

[0014]

第1の態様として、好ましくは、上記電極は、上記流路を挟んで対向して配置 される。上記粒子捕捉部は、突起部である。上記突起部は、上記流路を形成する 面の上記電極の一方側にその基端を有する。上記突起部は、上記基端から上記電極の他方側に向けて突出する。上記突起部の先端は、上記流路の略中央に配置される。

[0015]

上記構成において、粒子捕捉部である突起部は、流路内において流路を横断する方向の片側に配置される。溶液中の粒子は、電界によって引き寄せられ、突起部の基端側に引っ掛かって捕捉される。粒子捕捉部に留まった粒子は、例えば逆向きの電界が生じるように電極に電圧を印加して粒子捕捉部から遊離させ、下流に流すことにより、回収することができる。

[0016]

突起部は、任意の形状とすることができる。例えば、流路の横断方向に延在する板状としたもよい。あるいは、突起部で囲むことによりくぼみを形成し、このくぼみが流路の中央側に開口するようにしてもよい。粒子を効率的に捕捉するためには、好ましくは、複数の柱状の突起部を設け、突起部の間を溶液が流れるようにする。

[0017]

好ましくは、上記粒子捕捉部は、柱状の複数の上記突起部を含む。隣接する上 記突起部間の隙間は、0.1 μ m以上 5 0 μ m以下である。

[0018]

上記構成は、全血から、赤血球、白血球及び血小板を突起部に引っ掛けて除去 し、血漿成分を抽出する場合等に好適である。

[0019]

第2の態様として、好ましくは、上記流路は、流れ方向上流側に一つの主流路を含み、流れ方向下流側に上記主流路から分岐する2以上の分岐流路を含む。上記主流路と上記分岐流路との分岐点近傍において、互いに隣接する上記主流路及び上記各分岐流路の間にそれぞれ上記電極が配置される。

[0020]

上記構成において、いずれか一つの分岐流路について、その分岐流路を挟んで 両側に配置された電極には電位の異なる電圧をそれぞれ印加し、その分岐流路を 横断する方向に電界が生じるようにする。一方、他の分岐流路については、その 分岐流路を挟んで両側に配置された電極に同電位の電圧を印加する。これによっ て、分岐流路を横断する方向に電界が生じた分岐流路に、溶液中の粒子を引き寄 せ、その分岐流路に流れ込むようにすることができる。

[0021]

上記構成において、その両側に配置された電極に電位の異なる電圧が印加されて、その分岐流路を横断する方向に電界が生じる分岐流路が、選択的に粒子捕捉部になる。

[0022]

上記構成によれば、捕捉した粒子は分岐流路を流れるので、粒子の抽出が容易である。また、連続的に粒子を回収することができ、粒子捕捉部に留まった粒子を除去するための特別な操作は不要となる。

[0023]

好ましくは、上記電極は、シリコンの基板に高濃度の不純物をドープした低抵 抗部分として形成される。上記流路は、上記基板の上記不純物がドープされた領 域を部分的にエッチング加工により除去することにより形成される。

[0024]

上記構成によれば、マイクロマシニングプロセスを応用して、流路(主流路及び分岐流路)と電極を有する粒子分離機構を、容易かつ効率的に製造することができる。

[0025]

上記各構成の粒子分離機構は、溶液から粒子を分離する粒子分離装置に好適に 用いることができる。この場合、上記粒子分離装置は、上記粒子分離機構の上記 マイクロポンプを駆動するマイクロポンプ駆動回路と、上記電極に電圧を印加す る電圧印加回路と、上記マイクロポンプ駆動回路および上記電圧印加回路の動作 を制御する制御回路とを備える。

[0026]

また、本発明は、以下の粒子分離方法を提供する。

[0027]

粒子分離方法は、粒子分離機構を用いて、溶液中に含まれる粒子を分離するタイプの方法である。粒子分離方法は、上記粒子分離機構に形成された流路に、上記粒子を含む上記溶液を流す第1ステップと、上記流路を横断する方向に電界を生じさせる第2ステップと、上記流路を流れる上記溶液中の上記粒子を、上記電界の方向に寄せる第3ステップと、上記電界の方向に寄せられた上記粒子を、上記流路内の上記粒子が寄せられる側に形成されたマイクロストラクチャーで捕捉する第4ステップとを備える。

[0028]

さらに、本発明は、以下の粒子分離方法を提供する。

[0029]

粒子分離方法は、粒子分離機構を用いて、溶液中に含まれる粒子を分離するタイプの方法である。粒子分離方法は、上記粒子分離機構に形成された途中から少なくとも2つに分離する流路に、上記粒子を含む上記溶液を流す第1ステップと、上記流路の分離部近傍において、下流側の一方の流路側から下流側の他方の流路側に電界を生じさせる第2ステップと、上記電界により、上記流路を流れる上記溶液中の上記粒子を、下流側のいずれか一つの流路側に寄せ、その流路を流れるようにする第3ステップとを備える。

[0030]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の各実施形態に係る粒子分離機構について、図面を参照しながら 説明する。

[0031]

まず、第1実施形態の粒子分離機構について説明する。

[0032]

第1実施形態の粒子分離機構は、流路途中のマイクロストラクチャーの高さを 流路深さより低くして、フィルターによる極端な流路抵抗の増大を緩和する構成 とし、深さ方向のフィルターがない部分から分離したい粒子が逃げないように、 流路内のマイクロストラクチャーを形成した領域には、流路底と蓋との間に電圧 を印加できる構成にし、導電粒子(分離する粒子)を電気泳動によりフィルター 部分(マイクロストラクチャーを形成した領域)に引きつけておきながら、溶液をポンプ力で流して、粒子をマイクロストラクチャーを形成した領域に取り込んで分離する。

[0033]

具体的には、粒子分離装置(図示せず)に装填するマイクロチップ10を、図 1及び図2のように構成する。

[0034]

すなわち、図1 (a) の断面図に示すように、マイクロチップ10は、大略、 微小な流路14が基板10 b上に形成され、その上をカバー10 a で覆われてなる。例えば、マイクロチップ10の外形寸法は約 $20 \times 40 \times 0$. 5 mmである。流路14の幅は200 μ m、深さは約100 μ mである。

[0035]

流路14の一端には、矢印40で示すように溶液を供給するための液入口12が設けられ、他端には、矢印42で示すように溶液を排出するための液出口16が設けられている。流路14の途中には、溶液を液出口16側に送り出すためのマイクロポンプ13と、溶液中の粒子を捕捉するためのマイクロストラクチャー部20とが配置されている。

[0036]

詳しくは、図1(b)の模式平面図に示すように、2つの液入口12a,12bと、2つのマイクロポンプ13a,13bと、2つの液出口16a,16bと、分岐した複数の流路14a,14b,14c,14d,14eとを備える。マイクロポンプ13a,13bは、例えば振動板に圧電素子が貼り付けられていてユニモルフ駆動により送液を行うディフューザー型ポンプである。

[0037]

マイクロストラクチャー部20には、図2の要部拡大断面図に示したように、 流路14cを挟んで基板10bとカバー10aとに配置された電極24,26と、一方の電極24側から流路14cの略中央まで流路横断方向に突出した高アスペクト比の多数の突起部22とが設けられている。

[0038]

突起部 2 2 の高さ H は、流路の深さより小さい。隣接する突起部 2 2 間の隙間 G は、粒子サイズに応じて適宜に決定することができる。例えば、突起部 2 2 で全血から赤血球、白血球及び血小板を取り除き、血漿成分を抽出する場合等には、隣接する突起部 2 2 間の隙間 G は、0. 1 μ m以上 5 0 μ m以下とすることが 好ましい。

[0039]

電極24,26と突起部22とは、半導体の分野で用いられている微細加工技術を応用することにより、例えば図5に示した手順で形成することができる。

[0040]

すなわち、まず図 5 (a) に示したように、シリコンウエハー 7 0 を用意する。次に、図 5 (b) に示したように、シリコンウエハー 7 0 の上下面に、例えば 熱酸化により厚さ 1. $5 \mu m$ 程度の酸化膜 7 2, 7 4 を成膜する。

[0041]

次に、一方の酸化膜72にレジストを塗布、露光、現像した後、酸化膜72の一部をエッチングにより除去し、残ったレジストを剥離して、図5(c)に示すように、酸化膜72の一部72aを薄くする。

[0042]

次に、一部72aが薄くなった酸化膜72にレジストを塗布、露光、現像した後、酸化膜72のエッチングを行い、残ったレジストを剥離して、図5 (d)に示すように、流路14に対応する部分の酸化膜72を完全に除去し、突起部22に対応する部分に他よりも薄い酸化膜72bが残るようにする。

[0043]

次に、イオンを基板に加速することで異方性のドライエッチングを行うドライエッチング方法であるRIE (Reactive Ion Etching、反応性イオンエッチング)よりさらに深溝加工ができる異方性のドライエッチング方法であるICP (Inductively Coupled Plazuma、高周波誘導結合型プラズマ)またはDeep RIE (Deep Reactive Ion Etching、デープ・リアクティブ・イオン・エッチング)を用いて、シリコン70をエッチングする。次に、酸化膜72bを、エッチン

グにより除去する。これにより、図4 (e) に示すように、シリコンウエハー7 0には、突起22に隣接する部分70bを残し、流路14となる部分70aが途中まで除去される。

[0044]

次に、ICPを用いて、シリコンウエハー70をさらにエッチングする。これにより、図4(f)に示すように、シリコンウエハー70には、突起22となる部分70b と、流路14となる部分70a とが形成される。

[0045]

次に、図4(g)に示すように、残った酸化膜72をエッチングにより除去する。そして、シリコンウエハー70にカバー76を乗せ、例えば400°Cで90Vの電圧を印加して、接合する。

[0046]

上記各工程において、レジスト塗布は、例えば東京応化レジストOFPR80 0をスピンコートにより1.0μmの厚さとなるように行う。レジストの露光は 、例えばアライナイーによる。レジストの現像には、例えば東京応化の現像液N MD-3を用いる。酸化膜エッチングは、例えばCHF3を使用ガスとするリア クティブイオンエッチングにより行う。レジスト剥離には、例えば硫酸と過酸化 水素の混合液を用いる。

[0047]

基板10b側の電極24は、シリコンウエハー70の対応部分に予め高濃度の不純物(例えばアンチモンやボロン等)をドープして低抵抗とすることにより形成する。カバー10a側の電極26は、カバー10aと基板10bを接合する前に、予め金属を蒸着する等により形成しておく。

[0048]

マイクロチップ10が装填される不図示の粒子分離装置は、マイクロチップ10のマイクロポンプ13a,13bを駆動するマイクロポンプ駆動回路と、電極24,26に電圧を印加する電圧印加回路と、マイクロポンプ駆動回路及び電圧印加回路の動作を制御する制御回路とを備える。

[0049]

次に、マイクロチップ10を用いて粒子を分離する方法について説明する。

[0050]

例えば、粒子を含んだ溶液は、マイクロチップ10の一方の液入口12aに供給される。粒子を含んだ溶液は、マイクロポンプ13aにより流路14a,14c,14dを流れ、一方の液出口16aから排出される。

[0051]

このとき、図2に示すように、電極24,26に電圧が印加され、電極24,26間に電界が生じるようにすると、矢印44で示したように流路14cを流れる溶液中の粒子2は、負の電荷を有する場合、電極24側に引き寄せられ、電極24側に設けた突起部22に引っ掛かり、マイクロストラクチャー部20に留まる。そのため、矢印46で示したように、マイクロストラクチャー部20より下流側には溶液だけが流れる。つまり、粒子2を含む溶液から粒子2を分離して、液出口16aから溶液だけを回収することができる。

[0052]

次に、マイクロチップ10の他方の液入口12bに洗浄液を供給する。洗浄液は、マイクロポンプ13bにより流路14b、14c、14eを流れ、他方の液出口16bから排出される。

[0053]

このとき、電極24,26に例えば正負逆の電圧を印加し、電極24,26間に逆向きの電界が生じるようにする。これにより、マイクロストラクチャー部20に留まっている粒子2は、突起部22とは反対側の電極26側に移動し、洗浄液とともに液出口16bから排出される。つまり、分離された粒子2を液出口16bから回収することができる。

[0054]

マイクロチップ10は、溶液の主な推進力としてマイクロポンプ13a, 13bを用い、流路途中に突起部22によりフィルター(マイクロストラクチャー)を形成している。流路14cの略半分は、このフィルターで遮られないようになっており、粒子2はその部分からフィルター側に流れと直角方向に引き寄せられるので、粒子分離によりフィルターで急激な流路抵抗の増大が生じないようにす

ることができる。また、継続して溶液を送ることができ、粒子分離機能の経時劣 化が少ない。

[0055]

次に、第2実施形態の粒子分離機構について説明する。

[0056]

第2実施形態の粒子分離機構は、流路内には流路抵抗の増大になるフィルターを設けないで、流路途中にY字分岐部を設け、右側に電圧を印加したり左側に電圧を印加して電気泳動により導電粒子(分離粒子)を任意の方向に導いて分離する。

[0057]

具体的には、図3及び図4に示したマイクロチップ50を用いる。

[0058]

図3 (a)の断面図に示すように、マイクロチップ50は、大略、微小な流路54が基板50b上に形成され、その上をカバー50aで覆われてなる。マイクロチップ50は、前述したマイクロチップ10と略同様の寸法・構成である。

[0059]

流路54の一端には、矢印90で示すように液を供給するための液入口52が設けられ、他端には、矢印92で示すように液を排出するための液出口56が設けられている。流路54の途中には、液を送り出すためのマイクロポンプ53が配置されている。

[0060]

詳しくは、図3(b)の模式平面図に示すように、2つの液入口52a,52bと、2つの液出口56a,56bと、分岐した複数の流路54a,54b,54c,I,IIとを備える。流路54a,54bの途中には、マイクロポンプ53a,53bを備える。流路54cは主流路、流路I,IIは分岐流路である。

[0061]

流路分岐部54dの近傍60は、図4の模式図に示したように構成されている

[0062]

すなわち、流路54c側と流路I,II側との間には絶縁部X,Yが配置され、絶縁部X,Yと流路I,IIとの間には、互いに絶縁された3つの電極A,B ,Cが形成されている。

[0063]

具体的には、部分的に高濃度不純物(例えばアンチモンやボロン等)をドープ したシリコンの基板50bの低抵抗部分をエッチングにより加工して流路I,I Iを形成し、流路I,IIの壁が電極A,B,Cとなるようにする。

[0064]

マイクロチップ50は、各電極A,B,Cに例えば表1に示す組み合わせで電圧を印加することにより、負に帯電した粒子を流路I又はIIに導くことができる。

【表1】

| 分離方向 | Aの電圧 | Bの電圧 | での電圧 |
|------|------|------|------|
| 1 | + | _ | _ |
| П | _ | + | + |

[0065]

すなわち、電極Aに正、電極B及びCに負の電圧を印加すると、流路分岐部54d近傍では、図において下向きの電界が生じる。これにより、マイクロポンプ53により矢印94の方向に溶液とともに流れる粒子は、負に帯電している場合、流路分岐部54d近傍で図において上向きに移動し、流路分岐部54dの通過後は、矢印96で示すように流路I側を流れる。

[0066]

一方、電極Aに負、電極B及びCに正の電圧を印加すると、流路分岐部54d 近傍では、図において上向きの電界が生じる。これにより、負に帯電している粒 子は、流路分岐部54d近傍で図において下向きに移動し、流路分岐部54dの 通過後は、矢印98で示すように流路II側を流れる。

[0067]

分岐する流路は、2つに限らず、3つ以上であってもよい。

[0068]

例えば図6に示すように、3つの流路I、II、IIIと絶縁部X,Yとの間に、互いに絶縁された電極A,B,C,Dを設けた場合には、例えば表2に示した組み合わせで各電極A,B,C,Dに電圧を印加することにより、マイクロポンプPにより溶液に混ざって流れる負に帯電した粒子を、所望の流路に流路I、II又はIIIに流すことができる。

【表2】

| 分離方向 | Aの電圧 | Bの電圧 | Cの電圧 | Dの電圧 |
|------|------|------|------|------|
| I | + | _ | _ | _ |
| П | _ | + | + | _ |
| Ш | _ | _ | _ | + |

[0069]

」すなわち、図6において、粒子が流路分岐部近傍において上側、中央又は下側に寄せられるような電界を生じさせることにより、粒子を流路 I、 I I 又は I I I に導くことができる。

[0070]

マイクロチップ50は、溶液の主な推進力としてマイクロポンプ53を用い、 流路途中にフィルターを形成することなく粒子を分離することができる。分離された粒子は、粒子を分離する部分に留まらないので、粒子分離能力が時間ととも 劣化することはない。

[0071]

以上説明したマイクロチップ10,50は、粒子を分離するために補助的に電気泳動を用いているので、流路幅間に電圧を印加すればよい。通常、2~3kV/cmの印加電圧が必要であるが、流路幅はせいぜい200μm程度なので、印加電圧は40~60V程度となる。粒子の推進力として電気泳動を用いる場合には例えば数kVの電圧を印加するが、これと比べ、非常に低電圧の印加でよい。

[0072]

なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その他種々の態様で 実施可能である。

[0073]

例えば図4において、主流路54cに沿ってCCDラインセンサ等を配置して 主流路54c内における粒子の流路方向の移動を検出し、所望の粒子(例えば、 DNAや蛋白質を含む粒子)だけを流路I又はIIの一方に導いて選択的に回収 するようにしてもよい。

【図面の簡単な説明】

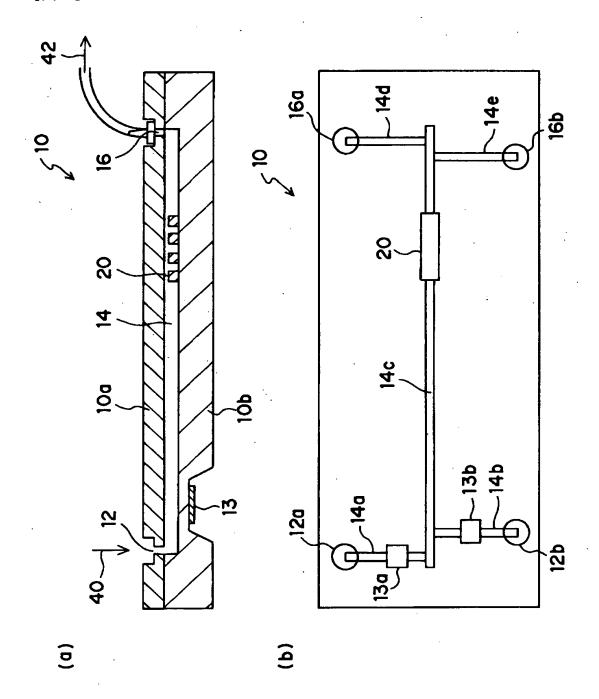
- 【図1】 本発明の第1実施形態の粒子分離機構であるマイクロチップの構成図である。
 - 【図2】 図1のマイクロストラクチャー部の要部拡大図である。
- 【図3】 本発明の第2実施形態の粒子分離機構であるマイクロチップの構成図である。
 - 【図4】 図3の要部模式図である。
 - 【図5】 図1のマイクロチップの製造工程説明図である。
 - 【図6】 変形例のマイクロチップの要部模式構成図である。

【符号の説明】

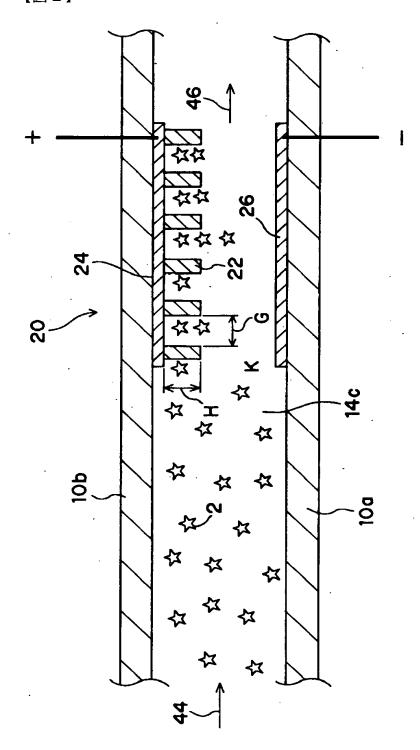
- 13a, 13b マイクロポンプ
- 14c 流路
- 20 マイクロストラクチャー部
 - 22 突起部(粒子捕捉部、マイクロストラクチャー)
 - 24,26 電極
 - 53 マイクロポンプ
 - 56c 主流路
 - I, II, III 分岐流路(粒子捕捉部)
 - A, B, C, D 電極

【書類名】 図面

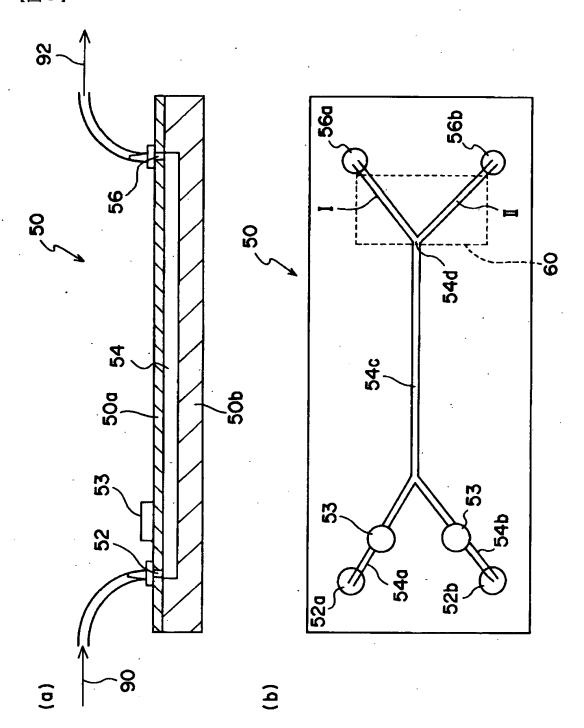
【図1】



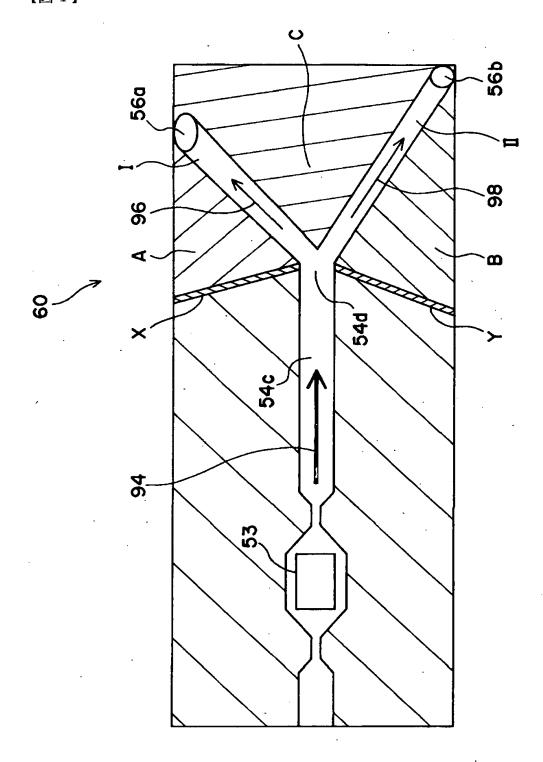
【図2】



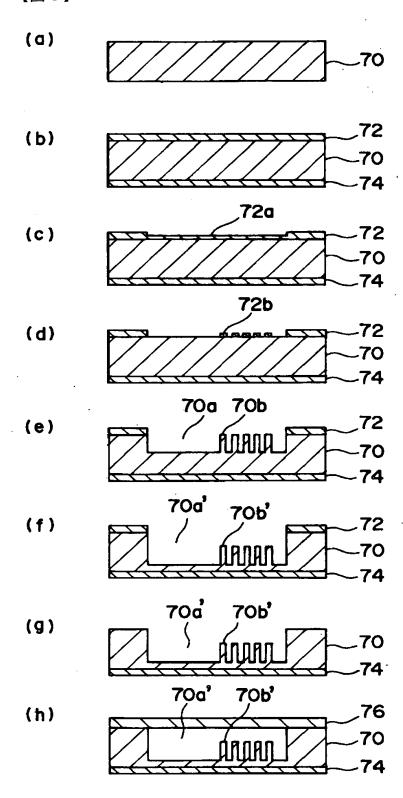
【図3】



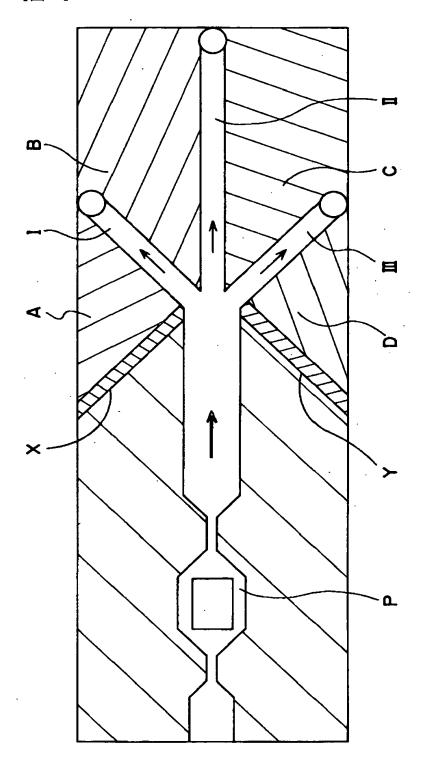
【図4】



【図5】



【図6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 粒子を連続して効率的に分離することができる粒子分離機構を提供する。

【解決手段】 粒子2を含む溶液が流れることができる流路と、粒子を含む溶液を流路に流すためのマイクロポンプと、流路の途中において流路を横断する方向に電界を生じさせるように電圧を印加することができる電極24,26と、流路内において上記電界により粒子2が寄せられる側に配置され該粒子2を捕らえることができる粒子捕捉部22とを備える。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号

[000006079]

1. 変更年月日 1994年 7月20日

[変更理由] 名称変更

住 所 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビル

氏 名 ミノルタ株式会社